

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【公開番号】特開2005-347579(P2005-347579A)

【公開日】平成17年12月15日(2005.12.15)

【年通号数】公開・登録公報2005-049

【出願番号】特願2004-166360(P2004-166360)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/00 (2006.01)

C 09 K 3/14 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 2 C

H 01 L 21/304 6 2 2 D

H 01 L 21/304 6 2 2 X

B 24 B 37/00 H

C 09 K 3/14 5 5 0 D

C 09 K 3/14 5 5 0 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年4月13日(2007.4.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

イミノ二酢酸(塩)基を有し、炭素原子数と窒素原子数とが炭素原子数／窒素原子数>7(ただし、この計算は、イミノ二酢酸塩基を有する場合におけるその塩部分の炭素原子数と窒素原子数は除いてなされること)の関係を満たす水溶性化合物を含む、研磨剤用添加剤。

【請求項2】

前記水溶性化合物は、イミノ二酢酸(塩)のNH基と反応する化合物とイミノ二酢酸(塩)との反応を用いて得られる化合物である、請求項1に記載の研磨剤用添加剤。

【請求項3】

前記水溶性化合物は、分子量が2000未満の化合物である、請求項1または2に記載の研磨剤用添加剤。

【請求項4】

前記水溶性化合物は、分子量が2000以上の化合物である、請求項1または2に記載の研磨剤用添加剤。

【請求項5】

イミノ二酢酸(塩)基を有する水溶性高分子化合物を含む、研磨剤用添加剤。

【請求項6】

前記水溶性高分子化合物は、重合性の不飽和二重結合を有しイミノ二酢酸(塩)のNH基と反応することができる化合物とイミノ二酢酸(塩)とを反応させてなるモノマーを重合させることにより得られる化合物である、請求項5に記載の研磨剤用添加剤。

【請求項7】

半導体中の金属の化学機械研磨用の研磨剤に用いられる、請求項1から6までのいずれ

かに記載の研磨剤用添加剤。

【請求項 8】

請求項 1 から 7までのいずれかに記載の研磨剤用添加剤を含む、研磨剤。

【請求項 9】

固体砥粒を含む、請求項 8に記載の研磨剤。

【請求項 10】

界面活性剤を含む、請求項 8または 9に記載の研磨剤。

【請求項 11】

無機塩を含む、請求項 8から 10までのいずれかに記載の研磨剤。

【請求項 12】

保護膜形成剤を含む、請求項 8から 11までのいずれかに記載の研磨剤。

【請求項 13】

半導体中の金属の化学機械研磨に用いられる、請求項 8から 12までのいずれかに記載の研磨剤。